

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 12 月 8 日 (2005.12.8)

【公表番号】特表 2001-525843 (P2001-525843A)
【公表日】平成 13 年 12 月 11 日 (2001.12.11)
【出願番号】特願 平 10-549994
【国際特許分類第 7 版】
C 07 H 19/06
【F I】
C 07 H 19/06

【手続補正書】
【提出日】平成 17 年 4 月 25 日 (2005.4.25)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】補正の内容のとおり
【補正方法】変更
【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成17年4月25日



特許庁長官 殿

1. 事件の表示 平成10年特許願第549994号
2. 補正をする者
 名 称 クラリアント・ファイナンス（ビー・ブイ・アイ）
 リミテッド
3. 代 理 人 東京都新宿区新宿1丁目1番11号 友泉新宿御苑ビル
 (郵便番号 160-0022) 電話 (03)3354-8623
 (6200) 弁理士 川 口 義 雄
4. 補正命令の日付 自 発
5. 補正により増加する請求項の数 なし
6. 補正対象書類名 請求の範囲
7. 補正対象項目名 請求の範囲
8. 補正の内容
 (1) 請求の範囲を別紙の通り補正する。

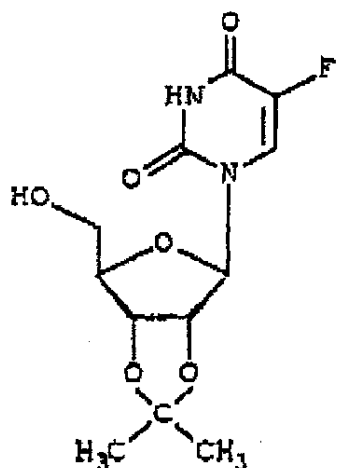


[別 紙]

請 求 の 範 囲

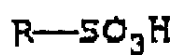
1.

(a) 式 I I の 2' , 3' -O-イソプロピリデン-5-フルオロウリジン



(II)

を式 I I I のスルホン酸の官能性誘導体

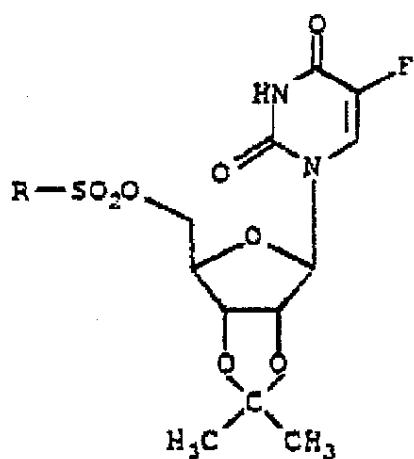


(III)

[ここで、Rは、(C₁~C₄)アルキル、トリフルオロメチル、非置換のフェニル基、
又はモノー、ジ-若しくはトリ置換されたフェニル基である]

と反応させること、

(b) このようにして得られた式 I V の 5' -スルホニルオキシ誘導体

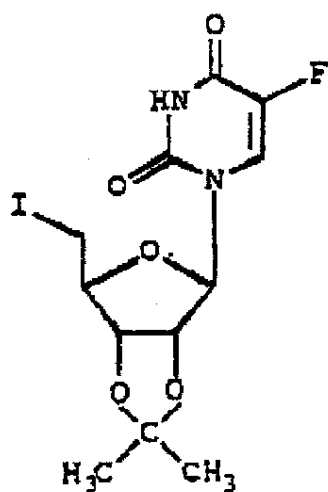


(IV)

(ここで、Rは上記と同じである)

をアルカリ金属ヨウ化物又はアルカリ土類ヨウ化物と反応させること、

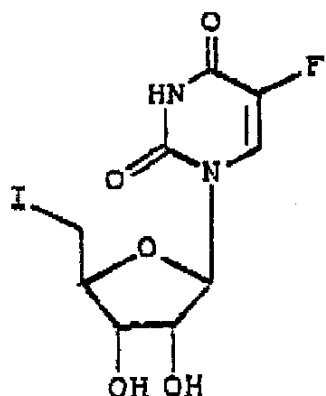
(c) このようにして得られた式Vの5'-デオキシ-5'-ヨード-2',3'-O-イソプロピリデン-5-フルオロウリジン



(V)

を酸性媒体中で加水分解すること、及び

(d) 式VIの5'-デオキシ-5'-ヨード-5-フルオロウリジン

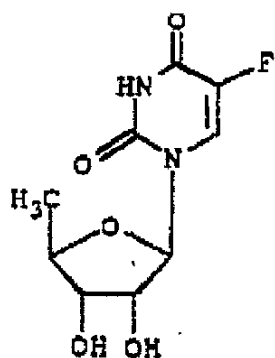


(VI)

を水素又は水素供与体による還元が付すること

を含むところの

式 I



(I)

の 5'-デオキシ-5-フルオロウリジンの製造方法。

2. 該式 I I I のスルホン酸の誘導体において、R が、メチル、エチル、*n*-ブチル、トリフルオロメチル、フェニル、又はメチル、メトキシ、ニトロ基若しくはハロゲンにより一置換されたフェニル、二つのメチル基により二置換されたフェニル、又は三つのメチル基により三置換されたフェニル、とくに 2, 4, 6-トリメチルフェニルであるところの請求項 1 記載の方法。

3. 工程 (a) において、式 I I I のスルホン酸の官能性誘導体として、クロリド、酸無水物又は混合酸無水物が使用されるところの請求項 1 記載の方法。

4. 式 I I I の酸の官能性誘導体が、メタンスルホニルクロリド、トリフルオロメタンスルホニルクロリド、ベンゼンスルホニルクロリド、*p*-トルエンスル

ホニルクロリド又は2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニルクロリドであるところの請求項3記載の方法。

5. 工程(a)、(b)及び(c)が、工程(a)及び(b)の夫々の最後において得られる生成物を単離することなしに実行されるところの請求項1記載の方法。

6. 工程(d)の還元が、接触水素化により実行されるところの請求項1記載の方法。

7. 活性炭上のパラジウムが触媒として使用されるところの請求項6記載の方法。

8. 該接触水素化が、塩基の存在下に実行されるところの請求項6記載の方法。

9. 該塩基が、第二級アミン又は第三級アミンであるところの請求項8記載の方法。

10. 該第二級アミン又は第三級アミンが、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン、N-エチルジイソプロピルアミン、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、モルホリン、N-メチルモルホリン、2-ピコリン又はキノリンであるところの請求項9記載の方法。

11. 該塩基が、重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウム又は他の無機塩基であるところの請求項8記載の方法。

12. 還元剤として、トリブチルスズ水素化物が使用されるところの請求項6記載の方法。

13. 還元が、触媒量の α , α' -アゾイソブチロニトリルの存在下に実行されるところの請求項12記載の方法。

14. 還元が、水素供与体としてシクロヘキセン又はシクロヘキサジエンを使用して実行されるところの請求項6記載の方法。

15. 該還元工程が、60～90℃の温度において実行されるところの請求項14記載の方法。